

界面ナノ電子化学研究会は半導体ウェットプロセスに関する様々な企業、研究機関および大学関係者により、半導体製造プロセスの学術的な解明、発展への貢献を重ねてきました。この度、1990年代後半から始まったDRAM不況や、シリコンサイクル不況時のリストラ嵐にも強く生き抜いた、本研究会に縁の深い偉大な諸先輩をお招きして、「生き様」「人生観」「強く生きる術」など人生を語って頂く機会を企画しました。老若男女問わず、半導体業界で今後も強く生き抜くために必要な術を大いに語り合ってください、合宿形式のフォーラムとして開催します。
“半導体ウェットプロセスの未来、どう生きる”を副題に掲げ、著名な講師の方々より興味深い講演を聴講し、幅広い職種の関係者が2日間に亘り、語り、交流し、議論する場を提供します。

半導体ウェットプロセスの未来を考える 「若手よ 続いてこい ベテランからのプレゼント」



- 主催： 公益社団法人応用物理学会 界面ナノ電子化学研究会(INE)
- 日時： 2018年11月1日(木)13:00～2日(金)12:30
- 場所： THE HAMANAKO (旧:浜名湖ロイヤルホテル)
〒431-0101 静岡県浜松市西区雄踏町山崎4396-1
《交通》JR東海道線 舞阪駅より車7分
(浜松駅からのバスを手配予定)
《地図》<https://www.daiwaresort.jp/hamanako/>



■プログラム：

1日目(11月1日 木曜日)

- 13:00～13:10 開会挨拶 吉水 康人 (東芝メモリ)
- 13:10～14:10 招待講演「製造業で働くミッション - 私の場合」
青砥 なほみ (マイクロメモリジャパン)
- 14:10～15:10 招待講演「人生いろいろ…VUCAの時代に生きる」
灘原 壮一 (SCREENホールディングス)
- 15:10～15:40 休憩(客室チェックイン)
- 15:40～16:40 招待講演「Job(任務),Carrier(経歴) and Calling(天職) Authentic Happinessより」
辻村 学 (荏原製作所)

16:40～18:00 自由時間

18:00～20:00 第25回カサロス(懇親会) 兼 ランプセッション ～半導体の未来を語り合う～

2日目(11月2日 金曜日)

- 9:00～10:00 招待講演「半導体洗浄技術概論・君は何に疑問を抱く？どう行動する？25年を振り返って」
富田 寛 (東芝メモリ)
- 10:00～11:00 招待講演「分析で『縁の下の力持ち』を目指してきた人生、また楽しからずや」
嶋崎 綾子 (東芝ナノアナリス)
- 11:00～12:20 ラウンドテーブルセッション(ポスターセッション)
- 12:20～12:30 閉会挨拶 若元 勇人 (ソニーセミコンダクタソリューションズ)

- 参加費：フォーラム参加費先行予約¥15,000(10月1日以降は¥20,000)、宿泊費¥12,000(食事、カサロス(懇親会)費を含む・相部屋) 合計¥27,000(10月1日以降は¥32,000)
※宿泊されない場合は要問合せ
※キャンセルポリシー：キャンセル料は次の通り発生します。前日100%、7日前50%
※支払方法：銀行振込(お申込頂いた方へ振込先をご連絡致します、振込手数料はご負担ください)
- 定員： 先着50名
- 申込： 参加者の①所属機関 ②部署名 ③役職名 ④電話番号を記載の上、下記までお申し込みください。
INEF実行委員 吉田勇喜(関東化学)

yoshida-yuki@gms.kanto.co.jp